Problem

- Extrem hohe Ebenheitsanforderungen (σ = ±0,1mm) an den Aufnahmeflansch für POD-Antriebe
- Ebenheitsverlust an der Flanschoberfläche durch Schweißdeformation infolge des Einschweißens der endbearbeiteten Flanschbaugruppe
- Durchführbarkeit der Ebenheitsmessung in Überkopfposition

Lösung

- Ebenheitsmessung mittels digitaler Photogrammetrie
- Vergleich der Messdaten mit einer mittleren Ebene
- Grafische und numerische Ausgabe des Messergebnisse

Nutzen

- Effektive Möglichkeit der Ebenheitsmessung hochgenauer Flanschverbindungen
- Höchsteffektives Durchführen von Wiederholungsmessungen (z.B. Analyse Schweißdeformation)
- Unter schwierigen Messbedingungen durchführbar (räumliche Lage Flansche; Messstandort)
- Schnelleres Ausrichten von Fräsmaschinen auf Basis der Messdaten für das anschließende Planen, falls Ebenheit außer Toleranz













